

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第4区分  
 【発行日】平成19年4月12日(2007.4.12)

【公開番号】特開2001-279446(P2001-279446A)  
 【公開日】平成13年10月10日(2001.10.10)  
 【出願番号】特願2000-92547(P2000-92547)  
 【国際特許分類】

**C 2 3 C 16/44 (2006.01)**  
**H 0 1 L 21/205 (2006.01)**  
**H 0 1 L 31/04 (2006.01)**

【F I】

C 2 3 C 16/44 J  
 H 0 1 L 21/205  
 H 0 1 L 31/04 V  
 H 0 1 L 31/04 X

【手続補正書】

【提出日】平成19年2月23日(2007.2.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

真空室と、  
 前記真空室内にガスを導入する手段と、  
 前記ガスを前記真空室外へ排気する手段と、  
 前記真空室内に電気エネルギーを供給する電極と、  
 前記電極に対向した基板を支持する手段とを備えたプラズマCVD装置であって、  
 前記ガスを導入する手段を、前記基板の前記電極側の表面近傍に設け、  
 前記基板と対向する前記電極表面に複数の開口を設け、  
 前記ガスを、前記複数の開口から前記真空室外へ排気することを特徴とするプラズマCVD装置。

【請求項2】

真空室と、  
前記真空室内にガスを導入する手段と、  
前記ガスを前記真空室外へ排気する手段と、  
前記真空室内に電気エネルギーを供給する電極と、  
前記排気する手段と前記電極との間に設けられた異常放電防止板と、  
前記電極に対向した基板を支持する手段とを備えたプラズマCVD装置であって、  
前記ガスを導入する手段を、前記基板の前記電極側の表面近傍に設け、  
前記電極及び前記異常放電防止板は複数の開口を有し、  
前記ガスを、前記複数の開口から前記真空室外へ排気することを特徴とするプラズマCVD装置。

【請求項3】

請求項1記載のプラズマCVD装置が、可撓性基板を連続的に搬送する機構を備えたことを特徴とするプラズマCVD装置。

【請求項4】

請求項 1 または請求項 2 記載のプラズマ C V D 装置において、電極表面の各開口部が円形で、電極表面全体に等間隔で並べたことを特徴とするプラズマ C V D 装置。

【請求項 5】

請求項 1 または請求項 2 記載のプラズマ C V D 装置において、電極表面に網状の板を用いたことを特徴とするプラズマ C V D 装置。

【請求項 6】

二つの対向する電極を用いた放電用電極であって、前記放電用電極の、少なくとも一つの電極表面に、複数の開口を設け、前記開口からガスを排気することを特徴とする放電用電極。